

※課題番号 : F-12-KT-0110  
※支援課題名 (日本語) : ナノインプリントによる接着性能の改善  
※Program Title (in English) : Improvement of adhesive performance with nanoimprint  
※利用者名 (日本語) : 瀧健太郎  
※Username (in English) : Kentaro Taki  
※所属名 (日本語) : 京都大学 (現 山形大学)  
※Affiliation (in English) : Kyoto University (Current: Yamagata University)

※概要 (Summary) :

ナノインプリント技術でヒートシール面にナノ構造を作成することにより、ヒートシールにおける接着性を改善する。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

該当なし

※実験 (Experimental) :

A04: 高速マスクレス露光装置 /D-light DL-1000GS/KCH にてシリコンウェハに塗布されたレジストにパターンを描写し現像後、B11: 電子サイクロtron共鳴イオンビーム加工装置/EIS-1200 にてシリコンウェハをエッチングした。その後 B10: ドライエッチング装置/RIE-10NR-KF にてレジストを除去することで型を完成させた。この型に UV ナノインプリント用の薬液を塗布し、B26: ナノインプリントシステム/EitreTM 3 にてポリエチレンフィルムにナノインプリントを施した。

※関連特許 (Patent) :

該当なし

※結果と考察 (Results and Discussion) :

ナノインプリントは成功し図1に示すパターンが得られた。

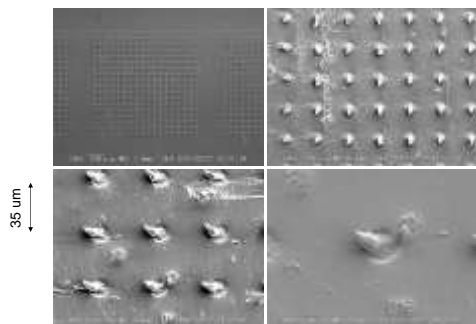


図1 ナノインプリにより形成されたパターン

※その他・特記事項 (Others) :

なし

※共同研究者等 (Coauthor) :

該当なし